

質 問 回 答 書

【9月28日受付分】

番号	質問事項	回 答
1	参加表明書類 様式4 第1面の①企業の設計能力 a 業務実績で基本設計と実施設計の契約が別々の場合、実施設計契約の内容を記載し基本設計契約書類は添付する形で問題ないかご教授ください。	基本設計と実施設計が一連の業務であり、かつ当該業務が平成28年4月1日以降に完了したことを確認できる場合は、御質問の方法で差し支えありません。 なお、基本設計と実施設計が別契約である場合は、実施設計の完了時期が平成28年4月1日以降であれば、基本設計の完了時期が同日以前であっても評価対象として取り扱います。

【9月29日受付分】

番号	質問事項	回 答
2	要求水準書 p. 3, 9 インフラ条件につきまして、給排水引込（接続先）をご教示願います。また、p. 9に構内配電線路についての記載がございますが、既設分岐とする場合の分岐元受変電設備の場所をご教示ください。	市水は正門から引き込んでいます。また、本館北側に受水槽、本館上部に高置水槽が設置されていますので、接続先は設計段階で検討してください。 排水は家庭科棟の東側に公設枥が設置されています。接続先は設計段階で検討してください。 分岐元受変電設備については、電気機械科北側に受電設備が設置されています。
3	要求水準書 p. 5 更衣室内にエアシャワー等は不要でしょうか。また、ダイサー室には前室やエアシャワー等は不要でしょうか。	不要です。
4	要求水準書 p. 5 小型半導体製造実習室は清浄度クラス4とありますが、5に設定していない理由がありましたらご教示願います。クリーンブース以外のエリアもクラス4が必要なのでしょうか。	要求水準書のとおりです。
5	要求水準書 p. 5 クリーンルームの換気方式につきまして、循環型・オールフレッシュ型の指定はないでしょうか。	指定はありません。各室の利用形態、運用方法、快適性、省エネルギー性、維持管理性、更新性及びライフサイクルコスト等を総合的に勘案の上、最適な方式を提案してください。

6	要求水準書 p. 5 諸室計画のうち更衣室、大講義室、PBL ルーム、CAD/CAE 演習室、企業ブースに「冷暖房設備を設ける」とありますが、暖房に関してはFF 暖房方式・空冷式ヒートポンプエアコンのどちらで対応するものとして考えたらよろしいでしょうか。	暖房設備の方式については、FF 暖房方式、空冷式ヒートポンプエアコンのいずれかを指定するものではありません。 各室の利用形態、運用方法、快適性、省エネルギー性、維持管理性、更新性及びライフサイクルコスト等を総合的に勘案の上、最適な方式を提案してください。
7	要求水準書 p. 6 「紫外線を遮断する光源を搭載した器具等を選定する」とありますが、小型半導体製造実習室内全てのエリアで紫外線遮断器具が必要でしょうか。それとも室内の特定のエリアのみに必要でしょうか。	必ずしも照明器具自体に紫外線遮断機能を有することを求めるものではありません。 照明器具への紫外線カットフィルターの設置その他の方法により、室内で使用する照明から発生する紫外線を遮断できることを求めるものです。
8	要求水準書 p. 6 「小型半導体製造装置用の排気設備を設ける」とありますが、清浄度維持用の換気とは別途で専用の排気設備が必要でしょうか。必要な場合、仕様や必要風量・台数をご指示ください。	清浄度維持用の換気とは別途で専用の排気設備が必要です。 排気設備の各系統の必要風量（小型半導体製造装置 20 台の合計）は以下を想定しています。 ① 一般排気（熱排気）系統 必要風量 10 m³/min 程度 ② TEOS (SiO₂ (酸化膜) 形成に使用する原料ガス) 排気系統 必要風量 20 m³/min 程度 ③ 塩素系排気系統 必要風量 20 m³/min 程度 排気設備の仕様は各排気ガスの性状に適したものとしてください。 排気ファンの台数は設計段階での検討とします。 ※ 設置機器未定のため、排気設備の系統及び必要風量は変更となる場合があります。
9	要求水準書 p. 6 「有機溶剤用ドラフトチャンバーの排気設備を設ける」とありますが、別途スクラバー（排気ファン共）の設置は無いということでしょうか。その場合、必要な換気設備の仕様や必要風量、工事区分（ダクト・換気機器共本工事となるでしょうか）をご指示ください。	スクラバーの設置は未定です。 排気設備の仕様は排気ガスの性状に適したものとしてください。 必要風量は未定のため、設計段階での検討とします。 工事区分は、ドラフトチャンバー接続から屋外開放まで（ダクト・排気ファン共）を本工事として想定しています。
10	要求水準書 p. 6, 12 ダイサー室に「電気錠による施解錠」とありますが、平面プランには電気錠の記載がご	要求水準書 P. 6 の記載を正とします。 平面図において電気錠がポンプ室に設置されているように見受けられますが、当該表記は

	ざいません。どちらが正でしょうか。	ダイサー室を対象としたものです。 なお、施解錠方式については、カードキー方式による運用を想定しています。
11	要求水準書 p. 6 「ダイサー用の排気設備を設ける」とございますが、清浄度維持用の換気とは別途で専用の排気設備が必要でしょうか。必要な場合、仕様や必要風量・台数をご指示ください。	清浄度維持用の換気とは別途で専用の排気設備が必要です。 排気設備の仕様は排気ガスの性状に適したものとしてください。 必要風量は5～7 m³/min程度を想定しています。 排気ファンの台数は設計段階での検討とします。 ※ 設置機器未定のため、必要風量は変更となる場合があります。
12	要求水準書 p. 6 「エアーコンプレッサーを設け、圧縮空気が必要な配置予定機器に圧縮空気を供給する」とございますが、圧縮空気の供給が必要な機器をご教示ください。	圧縮空気の供給が必要な機器は以下を想定しています。 ・オートマチックダイシングソー また、薬液処理室に圧縮空気接続口（予備用）の設置を検討しているため、当該箇所へも圧縮空気の供給が必要となる場合があります。
13	要求水準書 p. 6 エアー設備につきまして、下記それぞれの工事区分をご教示ください。 - I コンプレッサー本体 - II コンプレッサー～各室内エアー配管（カプラ設置まで） - III カプラ～機器接続	- I 本工事です。 - II 本工事です。カプラ設置の可否は設計段階での検討とします。 - III 設計段階での検討とします。
14	要求水準書 p. 7 使用する薬液の中で消防法上危険物に該当するものはございますか。ある場合、SDSシートのご提供と保管量・使用量のご教示をお願いいたします。	消防法上危険物に該当する薬液を6種程度使用する予定です。なお、危険物の貯蔵・取扱いについては指定数量未満を想定しております。薬液の種類及び SDS シート等は設計段階で提示します。
15	要求水準書 p. 7, 15 「ドラフトチャンバーの排気設備を設ける」とございますが、薬液処理室に設置予定のスクラバーには排気ファンは入っていないということでしょうか。入っていない場合、必要な換気設備の仕様や必要風量、工事区分（ダクト・換気機器共本工事となるでしょうか）をご指示ください。	排気ファンは別途工事での設置を想定しています。 排気設備の仕様は各排気ガスの性状に適したものとしてください。 必要風量は酸系統 20 m³/min 程度、アルカリ系統 20 m³/min 程度を想定しています。 工事区分は、排気ファン接続から屋外開放までを本工事として想定しています。

		なお、酸系統とアルカリ系統は、それぞれ独立した排気系統にする必要があります。 ※ 設置機器未定のため、必要風量は変更となる場合があります。
16	要求水準書 p. 14～ 別途購入設置予定機器の電気容量の記載がありません。各機器の電気容量をご教示願います。	【別表 No.16 回答】に記載します。
17	要求水準書 p. 14～ 上記機器において、無停電電源設備と接続が必要な機器をご指示ください。	別途購入設置予定機器においては、小型半導体製造装置を想定しています。
18	岩手県立学校施設整備指針 指針には「～することが望ましい」と記載されている項目が複数ありますが、実施が必須となる事項はあるのでしょうか。	岩手県立学校施設整備指針の記載のとおりです。
19	その他 消防設備につきましては法令で必要なものだけを設置すれば良いと考えてよろしいでしょうか。自主設置を希望される設備がございましたらご教示ください。	法令で必要なもののみとします。

【別表 No.16 回答】

設置予定機器装置名	電気容量
小型半導体製造装置	1. 5kVA／台程度を想定しています。
クリーンブース①（HEPA付恒温恒湿ブース）	2. 8kVA 程度を想定しています。
クリーンブース②	1. 5kVA 程度を想定しています。
レーザー顕微鏡	2. 0kVA 程度を想定しています。
FPD/LSI 検査顕微鏡	2. 0kVA 程度を想定しています。
システム実体顕微鏡	2. 0kVA 程度を想定しています。
卓上クリーンベンチ	1. 5kVA 程度を想定しています。
スピンコーター	1. 5kVA 程度を想定しています。
有機溶剤用ドラフトチャンバー	3. 0kVA 程度を想定しています。
除害装置	1. 5kVA 程度を想定しています。
走査電子顕微鏡	8. 5kVA 程度を想定しています。
マグネトロンスパッタ装置	1. 5kVA 程度を想定しています。
オートマティックダイシングソー	3. 3kVA 程度を想定しています。
酸用ドラフトチャンバー	1. 5kVA 程度を想定しています。
アルカリ用ドラフトチャンバー	1. 5kVA 程度を想定しています。

【10月1日受付分】

番号	質問事項	回 答
20	要求水準書 p.5 第2 設計業務に関する要求水準 「基礎形式は、地盤改良（GL-3m）を想定する」と記載されていますが、計画検討の参考として、既存校舎建設時の地盤調査報告書をご開示いただくことは可能でしょうか。 また、地盤調査報告書の開示が難しい場合は、想定する GL-3m 地点における地耐力（許容支持力度等）についてご教示ください。	公告時に提示した資料に基づき検討をお願いします。 なお、参考として、GL-3m 地点における地耐力は、150～200kN/m²程度を想定しています。
21	実施要項 p.1 2 事業の概要 本施設は「半導体実習施設」とされていますが、消防法施行令別表第一における防火対象物の用途区分については、学校（7項）として取り扱うものとの認識でよろしいでしょうか。	現段階の想定としては、貴見のとおりで差し支えありません。 なお、この取扱いについては、設計段階における所管消防機関との協議等により確認するものとします。
22	要求水準書 p.14. p.15 設置予定機器 計画建物の受変電設備容量の検討を行うため、設置予定機器の電気容量をご教示ください。	【別表 No.22 回答】に記載します。
23	要求水準書 p.5 小型半導体製造実習室内に、別途工事としてクリーンブースの整備が計画されておりますが、本事業で整備する実習室はクリーンルーム仕様とし、その室内にさらにクリーンブースを設置する計画との認識でよろしいでしょうか。あるいは、本事業では一般空調室を整備し、別途工事のクリーンブース内のみ所定の清浄度を確保する計画でしょうか。	小型半導体製造実習室はクリーンルーム仕様とし、その室内にさらにクリーンブースを設置する計画との認識でよろしいです。
24	要求水準書 p.5 小型半導体製造実習室について、要求水準書においてクリーンルームの洗浄度クラス4が示されておりますが、当該実習室内に設置予定のクリーンブース以外のエリアについてもクラス4の洗浄度が必要との認識でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
25	要求水準書 p.3 諸室の構成表の半導体製造・実習エリア、回路設計・シミュレーションエリア欄に記載さ	小型半導体製造実習室の収容人員は、40 名程度を想定しています。 その他の諸室の収容人員については、要求水

	れている各室の収容人員をご教示ください。	準書P.5～P.8に記載している各室の利用形態及び想定人数を参照してください。
26	企業実績および予定管理技術者の実績要件において、契約書等の証明資料を提出することとされていますが、同一案件を複数の評価項目で使用する場合、技術者の資格証の同一の契約書等を項目ごとに重複して提出する必要がありますか。 または、企業実績と管理技術者の実績が同一案件である場合、同一の契約書等を共通資料として1部のみ提出し、各評価項目での重複提出を省略しても差し支えないでしょうか。	御質問のような場合においては、重複する書類の提出を省略して差し支えありません。 （提出書類作成要領第2の1(2)添付書類において、「重複する書類については、1部の提出で可とする。」としています。）

【別表 No.22 回答】

設置予定機器装置名	電気容量
小型半導体製造装置	1.5kVA／台程度を想定しています。
クリーンブース①（HEPA付恒温恒湿ブース）	2.8kVA程度を想定しています。
クリーンブース②	1.5kVA程度を想定しています。
レーザー顕微鏡	2.0kVA程度を想定しています。
FPD/LSI検査顕微鏡	2.0kVA程度を想定しています。
システム実体顕微用	2.0kVA程度を想定しています。
卓上クリーンベンチ	1.5kVA程度を想定しています。
スピンコーター	1.5kVA程度を想定しています。
有機溶剤用ドラフトチャンバー	3.0kVA程度を想定しています。
除害装置	1.5kVA程度を想定しています。
走査電子顕微鏡	8.5kVA程度を想定しています。
マグネトロンスパッタ装置	1.5kVA程度を想定しています。
オートマティックダイシングソー	3.3kVA程度を想定しています。
酸用ドラフトチャンバー	1.5kVA程度を想定しています。
アルカリ用ドラフトチャンバー	1.5kVA程度を想定しています。

【10月5日受付分】※10月8日修正

番号	質問事項	回 答
27	親会社と子会社の関係、又は親会社を同じくする子会社同士の関係等同一グループ間での同一プロポーザルの参加は可能と考えて宜しいでしょうか。	実施要項等においては、御質問のような参加方法を妨げる規定は設けていません。 ただし、その結果として、プロポーザルの公平性又は公正性が損なわれると認められる場

		合は、実施要項第3 9 (10)に規定する不正行為として取り扱うことがあります。
28	実施要項 別記 リスク分担表 気象 除雪費用は想定できない為、別途と考えてもよろしいでしょうか。	通常の想定を大きく超える積雪（豪雪）の場合は、リスク分担表における「不可抗力」の適用が可能と考えます。
29	実施要領 別記 リスク分担表 物価変動 公告時から工事請負契約時までの資材・労務費の変動は記載されておりますが、工事着工から引渡しまでの資材・労務費の変動も協議可能と考えてよろしいでしょうか。	工事契約締結後における物価変動への対応については、本県の県営建設工事に適用される規定及び運用によるものとします。
30	工事車両駐車場及び現場事務所設置可能場所をご教示頂けますでしょうか。	設計業務で概ねの仮設計画を定め、工事請負契約後に協議の上、決定します。 なお、現時点においては、工事車両駐車場及び現場事務所の設置場所は学校用地内を想定しています。契約締結後、学校運営及び生徒の安全確保に配慮して提案いただくこととなります。
31	作業重機及び搬入資材の搬入経路をご教示頂けますでしょうか。	設計業務で概ねの仮設計画を定め、工事請負契約後に協議の上、決定します。 なお、現時点においては、作業重機及び搬入資材の搬入経路は正門又は西側通用口を想定しています。
32	学校行事による休工日数及び現場入場不可日をご教示頂けますでしょうか。	年間 16 日程度を見込んでいます。 なお、この日数は契約締結後、学校側と協議調整しお示しします。
33	事業概要書 第2 施設整備概要 履行期間 ② 建設工事 令和 11 年 3 月末までとなっておりますが、建物のお引渡し時期が令和 11 年 3 月末との理解で宜しいか。また、お引渡しの時期が早くなることはないかご教示願います。	よろしいです。(実施要項第2 3 (2)参照)

【10 月 7 日受付分】

番号	質問事項	回 答
34	審査基準 4 ページ 設計者実績等評価一覧① a 業務実績 設計実績（基本設計及び実施設計）の実績を評価する、とありますが、基本設計・実施設	設計実績（基本設計及び実施設計）については、基本設計及び実施設計の双方を実施した実績を評価対象としています。 このため、基本設計のみ、又は実施設計のみ

	計両方の実績が無いとしないのでしょうか。片方だけの実績の場合は実績ありとはなりません。ならない場合の評価点はどのようにしますでしょうか。	の実績については、当該評価項目における実績としては取り扱わず、評価点は付与されません。
--	--	---

【10月8日受付分】※10月9日修正、10月13日更新

番号	質問事項	回 答
35	要求水準書 5～7 頁 ③諸室計画、16 頁「別途工事」／質問回答 No. 9、13、15、16 質問回答 No. 9、13、15 で排気設備及び圧縮空気設備の工事区分が示されました。それ以外の次の設備について、本工事で整備する範囲と別途工事（半導体製造実習装置設置付帯工事）で整備する範囲の区分をご教示ください。 ①配置予定機器への電源供給（例：本工事は室内の分電盤までとし、分電盤から各機器までの配線は別途工事とする等）、②配置予定機器への給排水、③ガス配管。工事区分表等があれば、ご提示をお願いします。	小型半導体製造実習室、ダイサー室、SEM 準備室、SEM 室及びポンプ室に設置を予定している半導体製造実習装置に係る設備について、工事区分は以下のとおりとします。 【電気設備】 本工事は各室内の分電盤までを施工範囲とし、分電盤から各機器への配線・接続は別途工事とします。 【給排水設備】 本工事は各室内の所定位置までの給排水配管を施工範囲とし、当該接続ポイントから各機器への配管・接続は別途工事とします。 【ガス設備】 本工事は各室内の所定位置までのガス配管を施工範囲とし、当該接続ポイントから各機器への配管・接続は別途工事とします。 なお、詳細な接続位置及び接続方法については、受注者の提案を踏まえ、関係者との協議により決定するものとします。
36	要求水準書 5 頁 第 1 5 (2)、14～15 頁 2. 設置予定機器（参考）、16 頁「別途工事」／質問回答 No. 33 質問回答 No. 33 で、本工事の引渡しは令和 11 年 3 月末とされました。設置予定機器（参考）の納入・据付、半導体製造実習装置の設置付帯工事（フリーアクセスフロアを含む。）及び教育情報ネットワーク整備について、実施時期の想定をご教示ください。本工事の引渡し後に実施する想定でしょうか。本工事の工期内に実施する想定の場合は、機器の納入時期、別途工事の着手を希望する時期及び必要な期間をご教示ください。	設置予定機器（参考）の納入・据付、半導体製造実習装置の設置付帯工事（フリーアクセスフロアを含む。）及び教育情報ネットワーク整備については、令和 10 年 10 月から令和 11 年 3 月末まで（約 6 か月間）の実施を想定しています。 なお、これらの工事については、本工事の引渡し（部分引渡しを含む。）を受けた後に実施することを想定しています。 また、別途工事の実施時期、施工範囲及び施工手順については、設計段階において関係者との協議により調整する予定です。

37	要求水準書 5 頁【小型半導体製造実習室】、14～15 頁 2. 設置予定機器（参考）／質問回答 No. 9、14 質問回答 No. 14 で薬液の想定が示されましたが、ガスについては示されていません。関係法令の適用と安全対策を検討するため、実習で使用を想定しているガスの種類（可燃性ガス、毒性ガスの有無を含む。）とおおよその貯蔵量、並びにガス供給装置（ボンベ庫等を含む。）及び除害装置を本工事と別途工事のいずれで整備する想定かをご教示ください。	可燃性ガス及び毒性ガスの使用を想定しています。 ガスの種類、貯蔵量は設計段階で提示します。除外装置は、別途工事で整備する想定です。
38	要求水準書 3 頁 第 1 2. インフラ条件、9 頁 ⑥環境計画／質問回答 No. 2 質問回答 No. 2 で、分岐元の受電設備は電気機械科北側と示されました。受電方式（既設受変電設備からの分岐又は単独受電）の比較検討の参考とするため、同設備の変圧器容量及び現在の最大需要電力（又は契約電力）をご教示ください。	電子機械科北側の既設受電設備は、受電盤及び饋電盤で構成されていることから変圧器は設置されていません。 分岐する場合は、既設受電盤付近へ饋電盤を新設して、建設予定地付近へ変電設備を新設する想定をしています。 現在（令和 8 年 9 月時点）の最大需要電力は 101kW、契約電力は 158kW です。
39	P. 6～P. 7 各室共通（小型半導体製造実習室、ダイサー室、SEM 室、SEM 準備室、ポンプ室、薬液処理室） 「消火設備は配置予定機器に影響が少ないものとする。」との記載がありますが、本記載の趣旨についてご教示ください。 具体的には、以下のいずれを想定しているのでしょうか。 ① 消火設備（スプリンクラー、消火器、ガス系消火設備等）の設置にあたり、機器の配置計画や運用に支障を与えないことを求めるもの。 ② 火災発生時の消火活動において、消火剤や放水等による半導体製造装置・測定機器等への影響が少ない消火方式を求めるもの。	②を求めるものです。
40	P. 6 要求水準書 10/5 に回答いただいた 9/29 受付分の質疑 No. 8 回答の②、③ガス、質疑 No. 11 回答の排気ガスの種類や濃度が不明のため、塩素系排気でも問題ないシロッコファンを選定し、ダクトは塩ビダクトで屋外立上げのベンチレー	排気ファン及び排気ダクトの仕様は設計段階での検討とします。

	ターまでの条件として考えてよろしいでしょうか。	
41	電気引込は、建設予定地から工業技術科棟を挟んだ北側に設置されているキュービクルから分岐するものとして考えてよろしいでしょうか。	電気引込は、建設予定地から工業技術科棟を挟んだ北側に設置されているキュービクルからの分岐は想定していません。 分岐する場合は、電子機械科北側に設置されてある受電設備に饋電盤を新設して、建設予定地付近へキュービクルを新設する想定をしています。
42	電気引込は、既設キュービクルの電気容量が不明のため、本建物に必要な電気容量を見込んだ内容でキュービクルを改造する想定としてよろしいでしょうか。1 次側幹線のケーブルサイズについては既存ルート、幹線サイズ不明のため考慮しないものとしてよろしいでしょうか。	電気引込を分岐する場合は、電子機械科北側に設置されてある受電設備に饋電盤を新設して、建設予定地付近へキュービクルを新設する想定をしています。 よって、饋電盤を新設するために必要な既設受電設備の改造及び建設予定地付近まで高圧ケーブルの敷設、本建物に必要な電気容量を見込んだキュービクルの新設を想定しています。
43	給水引込みは、工業技術科棟南側の既存給水に接続するものとして考えてよろしいでしょうか。また、既設給水管の口径が不明のため、小口径で既設給水管から分岐し、受水槽設置と考えてよろしいでしょうか。	給水引込みは、工業技術科棟南側の既存給水に接続を想定しています。 なお、給水方式等の詳細については、設計段階において検討するものとします。
44	下水接続は、建設予定地北側校舎の既設桝に接続するものとして考えてよろしいでしょうか。また、既設桝の深さが不明のため、ポンプアップ設置想定としてよろしいでしょうか。	下水接続はお見込みの通りです。 また、ポンプアップ設置については設計段階での検討するものとします。
45	事業概要書「第 5 予算限度額」について、工事費の上限価格は 108,000 万円とされていますが、今回示されている計画内容を踏まえると、当該上限価格の範囲内で施工することは難しいと考えます。また、今回の提案書には見積金額を記載する項目がないことから、提案者が上限価格を超過していることを認識した上で提案書を提出し、優先交渉権者として選定された後、工事費が上限価格を上回ることが判明する場合も想定されます。このような場合、上限価格を超過していることを理由として、優先交渉権者の選定が取り消される、	本事業は、予算限度額の範囲内で必要な機能を満たす施設を整備することを基本的な考え方としています。 そのため、受注者には、予算限度額の範囲内に工事費が収まるよう最大限の工夫を求めますが、それでもなお予算限度額を超過することが見込まれる場合には、床面積の縮小等により事業費の調整を行うことを想定しています。 その際、半導体製造実習部門の機能は必須と考えており、その他の部門等については、予算の範囲内において、室面積の縮小や諸室の

	または失格となることはあるのでしょうか。 それとも、事業概要書のただし書きに基づき、優先交渉権者との協議により、予算額の増額、建築面積の縮小、仕様の見直し等を行い、事業費を調整するものと考えてよろしいでしょうか。	削減を含めた検討を設計業務の中で行うものとしています。(必要に応じて、半導体製造実習部門についても面積や仕様の変更を行う場合があります。)
46	参加表明書提出後に辞退する場合について、①第一次審査前、②技術提案書提出前、③最優秀者等特定前、④最優秀者等特定後から基本協定締結前の各段階において、指名停止、文書警告、非指名その他の不利益措置の対象となるかご教示ねがいます。 併せて、不利益措置の対象とならずに辞退できる最終時点をご教示ねがいます。	基本協定を締結するまでは、辞退したことを理由とする不利益な取扱いはありません。
47	N-E. X. T. ハイスクール構想においてテスト運用期間を含めて 2029 年 4 月 1 日からの運用開始と理解しております。本プロポーザル資料では工期が 2029 年 3 月末までとなっておりますが、テスト運用期間を見込むことで、工期が 2029 年 3 月末から前倒しになることはないとの考えでよろしいでしょうか。	No.36 のとおり
48	「岩手県立学校施設整備指針」P.12 7 構内交換装置電話機の設置基準表におきまして、特別教室棟の準備室に「必要に応じて一般電話機を設置する」と記載が有りますが、本計画におきまして設置要となりますでしょうか。	一般電話機の設置については、設計段階において検討するものとします。
49	校内放送、自火報設備につきまして、既設のアンプ、自火報受信機等の接続場所につきましてご教示ください。	校内放送の既設アンプ及び既設自火報受信機については、管理特別教室棟に設置してありますが、既設設備との接続については、設計段階において検討するものとします。
50	お支払い条件につきまして部分払いや出来高払いが可能でしょうか。	契約条件については、本県が通常発注する委託業務及び工事の取扱いに準じるものとし、本事業に係る支払い条件は、次のとおりを想定しています。 ・設計委託業務：不可 ・工事監理委託業務：可 ・建設工事：可 ※支払回数等の具体的な取扱いについては、契約時に協議の上、関係法令及び契約書の定めに従うものとします。

※ 質問書の受付は締め切りました。